



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ(21)(22) Заявка: **2011125991/15, 23.06.2011**

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
24.06.2010 US 12/822329(43) Дата публикации заявки: **27.12.2012 Бюл. № 36**

Адрес для переписки:

**129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"**

(71) Заявитель(и):

**ДЖОНСОН ЭНД ДЖОНСОН
КОНЗЬЮМЕР КОМПАНИЗ, ИНК. (US)**

(72) Автор(ы):

**УОЛТЕРС Рассел М. (US),
ГАНН Юэн Т. (US),
ГАНДОЛЬФИ Лиза (US),
ДЖОНСОН Донзел (US),
АНИМ-ДАНСО Эмманюэль (US)****(54) ПРОЗРАЧНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ С НИЗКОЙ РАЗДРАЖАЮЩЕЙ
АКТИВНОСТЬЮ И ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКИМ pH****(57) Формула изобретения**

1. Очищающая композиция для кожи, содержащая:

(a) низкомолекулярный несшитый линейный акриловый сополимер; и

(b) по меньшей мере одно неэтокселированное анионное ПАВ, составляющее более чем приблизительно 2% от очищающей композиции для кожи;

причем полное содержание ПАВ в очищающей композиции для кожи не превышает приблизительно 9 вес.% от очищающей композиции для кожи; pH указанной очищающей композиции для кожи составляет приблизительно 6,2 или ниже; и указанная композиция для кожи имеет от 70 тыс. отсчетов/с или менее в тесте на рассеяние света.

2. Очищающая композиция для кожи по п. 1, где указанное полное содержание ПАВ в очищающей композиции для кожи не превышает приблизительно 7 вес.% от очищающей композиции для кожи.

3. Очищающая композиция для кожи по п. 1, где величина оптического пропускания очищающей композиции для кожи составляет более чем приблизительно 90%.

4. Очищающая композиция для кожи по п. 1, где pH очищающей композиции для кожи находится в диапазоне от приблизительно 4 до приблизительно 6,2.

5. Очищающая композиция для кожи по п. 1, содержащая не более чем приблизительно 5 вес.% этокселированного ПАВ.

6. Очищающая композиция для кожи по п. 1, дающая 50 тыс. отсчетов/с или менее.

7. Очищающая композиция для кожи по п. 6, дающая 40 тыс. отсчетов/с или менее.

8. Очищающая композиция для кожи по п. 5, содержащая не более чем приблизительно 1 вес.% этокселированного ПАВ.

9. Очищающая композиция для кожи по п. 1, где указанный низкомолекулярный

несшитый линейный акриловый сополимер представляет собой сополимер, содержащий первый мономерный компонент, выбранный из группы, состоящей из одного или более α,β -этиленоненасыщенных мономеров, содержащих по меньшей мере одну карбоксильную группу, и второй гидрофобно модифицированный мономерный компонент, выбранный из группы, состоящей из одного или более α,β -этиленоненасыщенных некислотных мономеров, содержащих C_1 - C_9 -алкильную группу, включая линейные и разветвленные C_1 - C_9 -алкилэфиры (мет)акриловой кислоты, виниловые эфиры линейных и разветвленных C_1 - C_{10} карбоновых кислот, а также их смеси.

10. Очищающая композиция для кожи, содержащая:

- (а) низкомолекулярный несшитый линейный акриловый сополимер; и
- (b) по меньшей мере одно неэтоксилированное анионное ПАВ, составляющее более чем приблизительно 2 вес.% от описываемой очищающей композиции для кожи;
- (с) причем полное содержание ПАВ в указанной очищающей композиции для кожи не превышает приблизительно 9 вес.% композиции для кожи; рН указанной очищающей композиции для кожи составляет приблизительно 6,2 или ниже; величина оптического пропускания указанной композиции для кожи составляет более чем приблизительно 90%.

11. Очищающая композиция для кожи, содержащая:

- (а) низкомолекулярный несшитый линейный акриловый сополимер; и
- (b) по меньшей мере одно неэтоксилированное анионное ПАВ, составляющее более чем приблизительно 2 вес.% от описываемой очищающей композиции для кожи;
- причем полное содержание ПАВ в указанной очищающей композиции для кожи не превышает приблизительно 7 вес.% от очищающей композиции для кожи; рН указанной очищающей композиции для кожи составляет приблизительно 6,2 или ниже; и указанная очищающая композиция для кожи имеет от 70 тыс. отсчетов/с или менее в тесте на рассеяние света.